## 科学研究費助成事業 研究成果報告書



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,200,000円

研究成果の概要(和文):粉末のままで過渡吸収を測定するフェムト秒拡散反射分光法を、可視光応答光触媒で ある窒素ドープ酸化タンタルおよび窒化タンタルに適用し、光励起キャリアの初期過程を調べた。窒素ドープ酸 化タンタルの場合、数百ピコ秒の間に酸素欠陥へのトラップで過渡吸収信号が減衰すること、より長波長の光で 励起するほど信号減衰が大きいことが分かった。窒化タンタルの場合、数十ピコ秒の間にキャリア再結合で過渡 吸収信号が減衰すること、より長波長の光で励起するほど信号減衰が緩やかになることが分かった。これらの結 果は、光触媒設計における指針になり得ると期待される。

研究成果の概要(英文): Charge-carrier dynamics of nitrogen-doped tantalum oxide powder and tantalum nitride powder was studied by femtosecond time-resolved diffuse reflectance spectroscopy. In the case of nitrogen-doped tantalum oxide, it was revealed that the transient absorption signal decreased by trapping of oxygen vacancies in several hundreds of picoseconds, and the decay was higher by using the excitation light with longer wavelength. For tantalum nitride, it was revealed that the transient absorption signal decreased by carrier recombination in several tens of picoseconds, and the decay was slower by using the excitation light with longer wavelength.

研究分野:光化学

キーワード:光触媒 酸化タンタル 窒化 フェムト秒 過渡吸収 拡散反射

1.研究開始当初の背景

酸化チタンによる水の分解が発見されて 以来[1]、半導体光触媒の研究が盛んである。 最近ではエネルギー・環境問題の観点から水 素エネルギーが注目されており、光触媒を用 いた水の分解による水素製造の研究が世界 中で行われている[2]。

太陽光利用効率を向上させることは光触 媒の高活性化につながるため、より長波長の 光を吸収する光触媒の開発がすすめられて きた。その方法のひとつが、高い活性を示す が紫外光しか吸収しない光触媒を後処理す る方法である。酸化タンタル(Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)をアン モニア雰囲気で高温処理してオキシナイト ライド (TaON) および窒化物 (Ta<sub>3</sub>N<sub>5</sub>) を合 成し、価電子帯上端が上昇してバンドギャッ プが狭まることにより可視光を吸収するこ と、犠牲試薬存在下での水素発生、酸素発生 が可能であることが報告された[3]。また、こ れらを光電極とした可視光水分解も報告さ れ[4]、大変注目を集めた。さらに、価電子帯 の上に N 原子による不純物準位を形成させ た N ドープ Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (N-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> )も合成された[5]。

2.研究の目的

上記いずれの可視光応答化手法において も、光触媒活性の発現には、光励起された電 子・正孔(キャリア)がトラップや再結合な どの失活過程との競争に打ち勝って表面に 拡散し、酸化還元反応に使われることが必要 である。しかし、窒化処理でトラップや再結 合中心となる欠陥サイトが導入されるため、 可視光を吸収しても必ずしも高い触媒活性 を示すとは限らない。すなわち、このトレー ドオフの中で最適化することが必要となる。 この際、窒化処理によって生じる欠陥サイト が光励起キャリアの初期過程に及ぼす影響 を知ることができれば、制御して最適化する ための指針が得られるのではないかと考え た。

そこで本研究では、粉末の過渡吸収を測定 するフェムト秒拡散反射分光法を N-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> お よび Ta<sub>3</sub>N<sub>5</sub> に適用し、可視光応答化のための 窒化処理が光励起キャリア初期過程に与え る影響を明らかにすることを目的とした。

## 3.研究の方法

(1)試料の合成

試料は豊田中央研究所の森川健志博士、鈴 木登美子博士、佐伯周博士から提供を受けた。 N-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>はTa<sub>2</sub>O<sub>5</sub>粉末をNH<sub>3</sub>とArの混合ガス 雰囲気中で加熱処理(550))することによ り合成した。Nドープ量はXPSから9atom% と見積もられた。Ta<sub>3</sub>N<sub>5</sub>はTa<sub>2</sub>O<sub>5</sub>粉末をNH<sub>3</sub> とArの混合ガス雰囲気中で2度焼成するこ とにより合成した(1回目は800 で5時間、 2回目は820 で3時間)。得られた粉末が Ta<sub>3</sub>N<sub>5</sub>の単一結晶相からなることをX線回折 で確認した。 (2)フェムト秒過渡吸収の測定

粉末を石英セルに詰め、拡散反射型の光学 配置で測定した(室温、大気中)。信号は数 千パルス積算して取得し、%Absorption = 100 ×(1 -  $R_{ex} / R_0$ )で解析した。ここで、 $R_{ex}$ および  $R_0$ はそれぞれ、励起光照射時、未照射時の拡 散反射光強度である。

励起光には光パラメトリック増幅器から 得たフェムト秒パルスの高調波を用いた。励 起光強度は、キャリアが高密度に生成して二 次の再結合が起きないよう、過渡吸収の減衰 速度が励起光強度に依存しなくなることを 確認して決定した。

4.研究成果

(1)N-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>の光励起キャリア初期過程

図 1(a) に N-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>の過渡吸収スペクトルを 示す。励起波長は 295 nm であり、バンド間 遷移に対応する。光励起して 1 ps 後では、 420-780 nm のブロードな吸収帯が、820-1000 nm に長波長ほど強度が高くなる吸収帯が観 測された。 $Ta_2O_5(N F - \mathcal{J} x b) > 2 \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A}$ ル形状がほぼ一致したことから(図1(b))い ずれの吸収帯も Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 中に生じたキャリア (電子および正孔)に由来すると考えられる。 N-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>の場合、信号強度は時間と共に減衰 し、1 ns 後の信号強度は 1 ps の約 2/3 となっ た。<br />
一方、Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (N ドープなし)の<br />
場合、信 号減衰は非常に少なく、大部分が1nsまで残 った。この結果から、信号の減衰はNドープ によって生じた酸素欠陥によるキャリアト ラップに由来する可能性が示唆された。



図 1. (a) N-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>および(b) Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>のフェムト 秒過渡吸収スペクトル ( 295 nm 励起 )。

図 2 に N-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> をトリエタノールアミン (TEOA)と重メタノール(CD<sub>3</sub>OD)の混合 溶媒(体積比 1:3)に浸し、紫外光を照射す る前後の差スペクトルを示す。400-1500 nm に 600 nm 付近を中心とする幅広の吸収帯と、 1500-2500 nm に長波長ほど強度の高い吸収 帯が観測された。TEOA 分解反応に正孔が消 費されるため、観測されたスペクトルは N-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>中に溜まった電子の吸収スペクトル に相当すると考えられる。前者の吸収帯はピ ーク(600 nm 付近)を持つことから、トラッ プ準位に存在する電子(トラップ電子)の吸 収に由来すると考えられる。後者の吸収帯 (1500-2500 nm)は長波長ほど信号強度が高 いことから、伝導帯あるいは浅いトラップ準 位に存在する電子(伝導帯電子)の吸収に由 来すると考えられる。この結果から、過渡吸 収で観測された 420-780 nm のブロードな吸 収帯は主にトラップ電子に、820-1000 nm の 長波長ほど強度が高くなる吸収帯は主にト ラップ正孔に由来することが示唆された。



図 2.N-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> を TEOA 添加 CD<sub>3</sub>OD に浸して 紫外光を照射する前後の差スペクトル。

次に、励起波長を 355 nm および 430 nm と して測定を行った。N 2p による不純物準位か ら伝導帯への電子遷移に対応する。光励起し て 1 ps 後には、295 nm 励起とほとんど同じ形 状のスペクトルが観測された。一方、その後 の信号減衰は、長波長の光で励起するほど速 くなった。観測波長 960 nm のタイムプロフ ァイルを図 3 に示す。2 成分の指数関数と定 数の線形結合としてカーブフィットしたと ころ、減衰の時定数はいずれの励起波長でも 3~4 ps と 110~120 ps であること、その成分比 は長波長の光で励起するほど大きいことが 分かった。キャリア再結合の速度を決める律 速過程が存在することを示唆する結果であ り、詳細を検討中である。



図 3.観測波長 960 nm におけるタイムプロフ ァイルの比較。

(2)Ta<sub>3</sub>N<sub>5</sub>の光励起キャリア初期過程
 図 4 に硫酸バリウムで希釈した Ta<sub>3</sub>N<sub>5</sub>(5)

wt%)の過渡吸収スペクトルを示す(励起波 長350 nm)。光励起して1 ps には、490-560 nm に負の信号が(ピーク532 nm)、400-490 nm (ピーク450 nm)と560-1000 nm(ピーク918 nm)に正の信号が観測された。10 ps には 460-1000 n m の信号強度が大きく減少すると 共にスペクトル形状が変化し、2 つの正の吸 収帯(400-530 nm および530-1000 nm)を示 した。その後はスペクトル形状をほとんど変 えずに時間と共に緩やかに減衰した。



図 4.Ta<sub>3</sub>N<sub>5</sub>のフェムト秒過渡吸収スペクトル (350 nm 励起)。

光励起して1 ps に観測された負の信号は、 Ta<sub>3</sub>N<sub>5</sub> の吸収端近傍の吸収スペクトル形状と 対応していることから、基底状態の吸収が減 少したことに由来するブリーチ信号と考え られる。ブリーチ信号を除けば1 ps のスペク トル形状は Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> のそれと似ていることから (図 1(b)) 600-800 nm は主にトラップ電子 の吸収、800-1000 nm は主にトラップ正孔の 吸収であると考えられる。10 ps 後に負の信号 が消失したのはブリーチ信号が回復したた めであり、この時間内にキャリア再結合が起 きて基底状態に戻ったことを意味している。 940 nm 付近の信号強度は1 ps の約3割となっ ており、生じたキャリアの約7割が再結合し た可能性が示唆された。

次に、励起波長を 295 nm、445 nm、585 nm として測定を行い、励起波長依存性を調べた。 過渡吸収スペクトルの形状は、350 nm 励起の 場合(図4)とほぼ同じであった。一方、過 渡吸収信号の減衰は長波長の光で励起する ほど緩やかになった。図5に観測波長760 nm のタイムプロファイルを示す。295 nm 励起と 350 nm 励起のタイムプロファイルは誤差範 囲で一致した。一方、励起波長を445 nm、585 nm と長波長にするにつれて、励起直後の減 衰が遅くなり(図5inset)ナノ秒まで残る信 号の割合も多くなった。再結合を逃れるキャ リアの割合が変化することを示しており、こ の結果から、吸収端付近を励起したことによ って生じた長寿命キャリアが光触媒反応に 重要な役割を果たしている可能性が示唆さ れた。励起波長依存性の起源については、バ ンドギャップ以上のエネルギーを持つ光で 励起したことにより、その余剰エネルギーで キャリア温度が上がり、キャリア同士の衝突 が起きて再結合が促進されたのではないか と考えたが、この仮説では 350 nm 励起と 295

nm 励起で減衰曲線が誤差範囲で一致することを説明できない。引き続き検討進め、解明したいと考えている。



図 5. 観測波長 760nm におけるタイムプロフ ァイルの比較。

## <引用文献>

[1] A. Fujishima, K. Honda, *Nature*, **1972**, *238*, 37.

[2] A. Kudo, Y. Miseki, *Chem. Soc. Rev.*, **2009**, *38*, 253.

[3] G. Hitoki, T. Takata, J. N. Kondo, M. Hara, H. Kobayashi, K. Domen, *Chem. Commun.*, **2002**, 1698.

[4] M. Higashi, K. Domen, R. Abe, J. Am. Chem. Soc., **2012**, 134, 6968.

[5] T. Morikawa, S. Saeki, T. M. Suzuki, T. Kajino, T. Motohiro, *Appl. Phys. Lett.*, **2010**, *96*, 142111.

## 5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[学会発表](計5件)

<u>Ken-ichi Yamanaka</u>, Tomiko M. Suzuki, Shu Saeki, Takeshi Morikawa, Excitation Wavelength Dependence of the Charge-Carrier Dynamics in Tantalum Nitride, 日本化学会第 98 春季年会, 2018 年 3 月

<u>山中健一</u>、光触媒研究の紹介と SACLA (XFEL)への期待、日本放射光学会第9回若手 研究会、2017年9月

山中健一、鈴木登美子、佐伯周、森川健志、 窒化タンタルの光励起キャリア初期過程、 2017年光化学討論会、2017年9月

<u>Ken-ichi Yamanaka</u>, Tomiko M. Suzuki, Shu Saeki, Shunsuke Sato, Takeshi Morikawa, Charge-Carrier Dynamics in Nitrogen-Doped  $Ta_2O_5$  Powder Studied by Femtosecond Diffuse Reflectance Spectroscopy, The 9th Asian Photochemistry Conference, 2016 年 12 月

<u>山中健一</u>、鈴木登美子、佐伯周、佐藤俊介、 森川健志、窒素ドープ酸化タンタルのフェム ト秒拡散反射分光、2016年光化学討論会、 2016年9月

- 6.研究組織
- (1)研究代表者

研究者番号:40418455